

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **04206548** A

(43) Date of publication of application: 28 . 07 . 92

(51) Int. CI

H01L 21/68 B65D 85/00

(21) Application number: 02329276

(22) Date of filing: 30 . 11 . 90

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

MURAI YOICHI

(54) WAFER CASSETTE FOR SEMICONDUCTOR

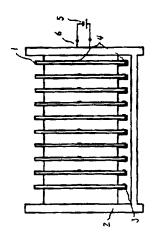
(57) Abstract:

PURPOSE: To inhibit wafers from vibrating or moving in groove parts and to contrive to prevent the generation of a failure in the wafers and the generation of a chipping by a method wherein a low-dust generating material film is used for the contact parts of the grooves in a cassette to the wafers and mechanisms, by which the wafers are pressed and fixed, are respectively provided in each groove part.

CONSTITUTION: Grooves for holding wafers 1 in a cassette are covered with a film 3 consisting of a low-dust generating material, such as a polycrystalline diamond film, a hand carbon film, a quartz film or the like. Sheet type piezoelectric mechanisms 4 covered with a low-dust generating material film are respectively provided in the groove parts in the cassette 2 and in a state that an external power supply 5 is not connected to the mechanisms 4, the wafers 1 are pressed and fixed in the groove parts by the mechanisms 4. When the power supply 5 is connected to the mechanisms 4 at contacts 6, a voltage is applied to the mechanisms 4 and the mechanisms 4 are deformed so as to free the wafers. Thereby, the wafers are prevented form being

contaminated or damaged.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

平4-206548

fint. Cl. 5

織別記号

庁内整理番号

图公開 平成4年(1992)7月28日

H 01 L 21/68 B 65 D 85/00

V H 8624-4M 8921-3E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半導体用ウエハカセット

②符 颐 平2-329276

②出 願 平2(1990)11月30日

@発明者 村井

洋 —

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

⑦出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の代理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

明 却 🛥

1.発明の名称

半導体用ウエハカセット

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は低発度な材料のウエハ接触部への使用 とウエハカセットの裸部に設けたウエハ固定装置 を持つ半導体用ウエハカセットに関する。

〔從来の技術〕

特開平2~89337号公報に記載のように、半導体 用ウエハの収容器である従来のカセットでは、ウ エハを保持するための海の幅が、ウエハの厚さよ り大きく作られており、カセット内にウェハを収容した運搬や保管する際に、この簿の中でウェハが援動したり、移動したりして、ウェハの破損やチッピングが起こるという意大な欠陥がある。また、ウェハカセット内のウェハ接触部は、機震や全異等で作られており、ウェハとの接触により、接触部からの発塵やウェハへの接触部材や異物の付着等によるウェハ汚染の要因がある。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記従来装置は、ウェハの運動や保管する際に、 沸の中でウェハが扱動したり、移動したりして、 ウェハの破損やチッピングが起こったり、ウェハ との接触により、接触部からの発重やウェハへの 接触部材や異物の付着等によるウェハ汚染が起こ るなどの問題があった。

本発明は、ウエハとの接触部からの発慮やウエ ハへの接触部材や異物の付着等を抑えることを目 的とする。

さらに、ウエハカセットの課部内でのウエハの 級動や移動を抑え、ウエハの破損やチッピングの 発生を体減することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記目的を連成するために、本発明はウェハと の接触部に低発度材料を使用したものである。

さらに、カセットの滞部内でのウエハの振動や 移動を抑え、ウエハの破損やチッピングの発生を 低減するために、カセットの滞部にウエハ固定機 標を付加したものである。

(作用)

ウエハカセット内のウエハ接触部に低発達材料を付加することは、ウエハ接触部でのウエハの扱動や移動による発度や接触部材や異物の付着を抑える作用がある。それによってウエハは、接触部からの発度や接触部材、異物の付着によって汚染されることがない。

さらに、ウエハカセットの裸部にウエハ百定機 標を付加することは、このアの中でウエハが振動 や移動をしないように動作する。それによって、 ウエハは破損やチッピングを起こさないようにな る。

てウエハ1の厚さtに関して、d<(w‐t)/2 という関係を満たすように、低発塵材料3′の大 きさるを決める。第4回および第5回の側面図と 拡大図を参照にして、本発明に関するウェハ固定 機構をもつ半導体用ウエハの収納器であるカセッ トの構造を説明する。第5箇に示すように、外部 電廠 5 とカセット本体 2 内にある回路が接点 6 で 切断されているとき、つまり、タエハ固定のため のシート型PZT機構4に電圧が供給されていな いとき、ウエハ1を低発度材料3が被覆されてい る準何面に押し付けるようになっている。ただし、 ウエハI裏面を押し付けるシート型PZT4の表 面には、低発度材料を被覆する。また、カセット 本体2内にある回路は、ウエハ固定のためのシー ト型PZT機構4を、外部電源5に対して並列に 接続したものである。また、第4回に示すように。 カセット 2 にウエハ間定のためのシート型PZT 4を側面と底面の少なくとも三箇所以上に配置す る。第6回は、第5回で切断されていた接点6を 接続させた際の拡大図を示す。この図より、外部

〔亥施例〕

以下、本発明について図面を参照して説明する。 第1回および第2回の側面図および拡大図を栽 照して、 本発明に関する半導体用ウェハの収納器 であるカセットの構造を説明する。第2回に示す ように、カセット中のウエハ1を保持する課は、 多緒晶ダイヤモンド膜,硬質炭素膜または石莢膜 の低発塵材料の膜3によって被覆する。ただし、 ウエハの厚さtと被覆した課の何bに関し、tく b という関係を満すように、低発度材料3を被覆 する。このように溝全体に低発塵材料3を被覆す ることにより、ウエハ1とカセット材2との直接() の接触をなくし、ウエハ1の汚染を抑える。第1 国のように、低発度材料3のウエハ1が接触する **淳全体に被覆する。第3図の拡大図を参照にして、** 第2回のように、溝全体に腰を被覆するのではな く、滯侇面にダイヤモンド。石英の単体の低発度 材料3~をつけることにより、第1図や第2図よ り簡易に同等の効果を得る一実施例である。ただ し、低発塵材料3′の大きさd、溝の裾w′そし

電源5を内部回路に接点6で接続すると、ウェハ 固定のためのP2T機構4に電圧がかかりシート 型P2T4が変形する。ただし、図のようにウェ ハ1を自由にするように変形する。シート型P2T4 に供給する電圧は、シート型P2T4の変形によってできた幅 b がウェハの厚さ t よりも大きくなるようにする。

〔発明の効果〕

本発明によれば半導体用ウェハの収納器である カセットを使用することによって、半導体素子を 形成するウェハ表裏面はダイヤモンドや石英の単 体や多結晶ダイヤモンド膜や硬質炭素膜の低発度 材料と接触するので、付着の汚染をまぬがれるし、 カセット内のウェハ保持のための固定機構により、 カセットの運搬や保管の際、ウェハの損傷。欠損 がなく、高歩智まりの半導体の生産が可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の半導体用ウェハカ セットの側面図、第2図は本発明の低発度材料を 鹹状にして付けたカセットの様とウェハの位置例

特閒平 4-206548(8)

係の説明図、第3回は、本発明の低発塵材料を単体で付けたカセットの溝とウェハの位置関係の説明 国、第4回は本発明の一実施例のウェハ国区機構を有する半導体用ウェハカセットの溝とウェハの位置関係の説明図、第6回は外部電源を接続した際のウェハ固定機構をもつカセットの溝とウェハの位置関係の説明図である。

1 …半導体ウエハ、2 …収納器カセット、3 …多 結晶ダイヤモンド膜、硬質炭素膜、又は石英膜の 低発度材料、3′ …ダイヤモンド、又は石英単体 の低発度材料、4 …シート型 P Z T ウエハ固定機 標、5 …外部電源、6 …接点。

代理人 弁理士 小川鮮男



